科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 2 6 年 6 月 6 日現在

機関番号: 3 4 4 1 6
研究種目:挑戦的萌芽研究
研究期間: 2012 ~ 2013
課題番号: 2 4 6 5 6 4 2 0
研究課題名(和文)光照射による機能切換が可能な金属製生体材料表面の創製
研究課題名(英文)Fabrication of function-switchable surfaces in metallic biomaterials
研究代表者
上田 正人 (Ueda Masato)
関西大学・化学生命工学部・准教授
研究者番号:4 0 3 6 2 6 6 0
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,200,000円、(間接経費) 960,000円

研究成果の概要(和文):熱処理や光照射によって,生体不活性な酸化物を生体活性に,生体活性な酸化物を生体不活性にできるか検討した。純Zr表面に湿式合成したZr02膜の表面状態は,熱処理や光照射に敏感ではなかった。一方,純 Ti表面に湿式合成したTi02膜では,熱処理によって表面の水酸基密度を低下させることができた。逆に,紫外光を予備 照射することで擬似体液中でのアパタイト析出を促進することもできた。これは,生体活性の回復に相当する。また, 紫外光の連続照射によって,表面の帯電状態を制御できる可能性も示された。このように湿式合成されたTi02では,光 照射を機能切換えのトリガーとして利用できることが示唆された。

研究成果の概要(英文):Hydroxyapatite (HAp) is known to precipitate on bioactive materials by soaking in simulated body fluid (SBF). The formation of HAp on TiO2 and ZrO2 surfaces under ultraviolet (UV) irradiat ion was investigated. HAp formation on ZrO2 surface was not sensitive to heat treatment and UV irradiation. In contrast, the HAp formation on the TiO2 in SBF was strongly influenced by heat treatments and UV irradiation. Hydroxyl group density on TiO2 surface could be decreased by the heat treatment. Then the density could be recovered by previous UV irradiation, it led to promotion of HAp formation. This means recovery of bioactivity on the TiO2 surface. The UV light produced electron-hole pairs in the TiO2, and the photoge nerated holes that migrated to the surface repelled the positively charged ions in the solution. As a cons equence, the continuous UV irradiation suppressed the formation of HAp. These results suggest that several functions in TiO2 might be switched by light irradiation.

研究分野:工学

科研費の分科・細目: 材料工学・構造・機能材料

キーワード: 生体材料 機能切換え 光照射

1. 研究開始当初の背景

金属製生体材料の表面にハイドロキシアパタ イト(HAp)やTiO₂等の生体活性なセラミックス膜 をコーティングし, 骨伝導を向上させる研究が盛 んに行われている。研究代表者は同様の研究 [1] に加え, 逆に骨と直接結合しないTiの表面 修飾法の開発 [2] も併せて行っている。現在は 骨伝導を促進, 抑制するとされるTiO₂, ZrO₂をそ れぞれ金属表面に合成・担持しているが, その 物質上での骨伝導を支配している因子は明らか となっていない。研究代表者は, そのような生体 反応は, 特に毒性の高い物質を除き, 物質その ものではなく, 材料表面の官能基やその密度, 電気的チャージに強く支配されているのであろう と想像する。

光触媒や湿式太陽電池は半導体/水溶液界 面でのバンドベンディング,光励起電荷の分離, 表面の官能基密度変化や電気的チャージを巧 妙に利用している。これらは上述したインプラン ト表面の骨伝導を支配していると考えている因 子である。そこで,この光化学反応を金属製生 体材料における表面状態を制御するツール,さ らには生体機能の切換トリガー(スイッチ)として 利用できないかと考えた。

研究の目的

純 Ti, 純 Zr 表面に光応答性を有する酸化物 薄膜を合成し, 以下の事項を解明することを目 的とした。

- (1) 水熱処理と熱処理によって合成膜の結晶性 をどの程度制御することができるか?
- (2) 酸化物膜の光応答性は?光照射によって 表面の濡れ性がどのように変化するか?
- (3) 擬似体液浸漬試験における HAp 析出に光 照射の効果が反映されるか?
- 3. 研究の方法
- 3.1 酸化物膜の合成

純 Ti は, 80 °C に保持した 5 M H₂O₂/0.1 M HNO₃ 混合水溶液に 20 min 浸漬することで化 学処理(Chem)を施した。一方,純 Zr は,0.7 M H₃PO₄ 水溶液中で,直流電源を用いて 30 V 印 加し,陽極酸化処理(A.O.)を施した。化学処理 を施した純 Ti と陽極酸化処理を施した純 Zr は,引き続き,テフロン容器中で 1 M NH₃ 水溶液に それぞれ浸漬し,180 °C-12 h の水熱処理(Hyd) を施した。一部の試料は,大気中で 400 °C -1 h, 5 h の熱処理(HT)を施した。

3.2 酸化物膜のキャラクタリゼーション

表面観察は, FE-SEM (JEOL-6500F), 合成 物質の同定は, TF-XRD (RINT-2500, Incident ang.=1°)で行った。酸化物膜の光応答性は, ブ ラックライト(λ=254 nm, 2020 μW/cm²)とポテン シオスタット(HZ-5000)を使用し, リニアスィープ ボルタンメトリーで光電流を測定することで評価 した。Pt 対極, Ag/AgCl 参照電極, 電解液には Hanks 溶液を用いた。水滴接触角は, 接触角計 (ECA-1)で純水 1μLを滴下し, θ/2 法で求めた。 擬似体液 (SBF)浸漬試験として, 各種処理を 施した TiO₂ 膜, ZrO₂ 膜を 37 ℃ に保持した Kokubo 溶液に暗所で2~10 days 浸漬した。さら に,初めの 10 hだけ,SBF 中で紫外光照射を行 い,その後は暗所下で SBF 浸漬を続けるパター ン(Pre. UV)と SBF 浸漬中,連続的に紫外光照 射を行うパターン(Cont.UV)も行った。

4. 研究成果

4.1 酸化物膜の合成

化学処理, 水熱処理, 熱処理後の純 Ti 表面 における生成物の XRD プロファイルを Fig.1 に 示す。純 Ti に化学処理を施すと表面に結晶性 が非常に低いアナターゼ型 TiO₂(TiO₂ ゲル) 膜 が合成された。水熱処理を施すとその回折ピー クはシャープになり, 結晶性が向上したことがわ かる。熱処理を施すとそのピークはさらにシャー プになり, 結晶性はさらに向上した。水熱処理, 熱処理によって, ルチル型 TiO₂等, 他の相の出 現は認められなかった。

化学処理, 水熱処理, 熱処理後の純 Ti 表面 における生成物の SEM 像をFig.2 に示す。化学 処理によって合成した TiO₂ ゲル膜表面は, スポ ンジ(網目)状を呈した。水熱処理を施すと, 一 辺が 50 nm 程度の立方体状の結晶が観察され た。水熱処理中に TiO₂ の溶解・再析出が活発 に生じたことが窺える。この形態は, 熱処理に よってまったく変化しなかった。



Fig.1 化学処理, 水熱処理, 熱処理後の純 Ti における表面生成物の XRD プロファイル.



500 nm

Fig.2 化学処理, 水熱処理, 熱処理後の純 Ti における表面生成物の SEM 像.

一方の純 Zr にも純 Ti と同様の化学処理を施 した。しかしながら,表面に変化が認められな かった。そこで, 80 ℃ に保持した 8 M H₂O₂/0.1 M HNO3 混合水溶液に 20 ~120 min 浸漬した。 90 min 以上の化学処理で干渉色(薄い黄色)が 認められたが,TF-XRD では Zr 以外のピークを 検出することはできなかった。さらに,8 М H₂O₂/0.1 M HNO₃ 混合水溶液による 180 ℃-2 h の水熱処理も試みたが,表面に明瞭な ZrO2 膜 を合成することはできなかった。そこで, 純 Zr に おいては,最初の処理として陽極酸化処理を選 択した。陽極酸化処理,水熱処理,熱処理後の 純 Zr における表面生成物の XRD プロファイル を Fig.3 に示す。純 Zr に陽極酸化処理を施すと 基板である Zr の回折ピークに加え, ブロードな 単斜晶 ZrO₂, 正方晶 ZrO₂の回折ピークが確認 された。水熱処理を施すと単斜晶の回折ピーク のみシャープになり,結晶性が向上した。熱処 理を施すと,さらに単斜晶のピークがシャープに なり,結晶性が向上した。一方,正方晶ピークに は顕著な変化は認められなかった。

陽極酸化処理,水熱処理,熱処理後の純 Zr 表面における生成物のSEM像をFig.4に示す。 XRDでは,ZrO2膜の存在を検出できたが, SEMでは,平坦な表面が観察されるにとどまっ



Fig.3 陽極酸化処理,水熱処理,熱処理後の 純Zrにおける表面生成物のXRDプロファイル.



500 nm

Fig.4 陽極酸化処理, 水熱処理, 熱処理後の 純 Zr における表面生成物の SEM 像. た。ZrO2 膜は確かに合成されているが、非常に薄いことを示唆している。

化学処理, 陽極酸化処理で純 Ti, 純 Zr 表面 に合成した結晶性の低い TiO2 膜, ZrO2 膜に, 水熱処理, 熱処理を施した際, その膜の結晶性 がどのように変化したか検討するため, 合成膜 のXRDプロファイルにおけるメインピークの半値 幅を比較した(Fig.5, Fig.6)。いずれも水熱処理, 熱処理によって結晶性は向上した。TiO2 では, 化学処理後から水熱処理後にかけての変化が 著しかった。一方, ZrO2 では, 水熱処理, 熱処 理による結晶性の向上は, TiO2 のそれに比べて 非常に緩やかであった。



101ピーク半値幅の変化.



 Fig.6 水熱処理,熱処理によるZrO2の

 111ピーク半値幅の変化.

4.2 酸化物膜の諸特性

4.2.1 光応答性

合成した酸化物膜の光応答性を調べるため, 紫外光照射下の光電流を測定した。試料は Hanks 溶液に水面から 5 mm の深さにセットし, 上部から波長 254 nm の紫外光を照射した。 TiO₂ と ZrO₂ のエネルギーバンドギャップは, そ れぞれ 3.2 eV, 5.0 eV であることから, 紫外光の 波長として 254 nm を選択した。

リニアスィープボルタンメトリーで測定した光電 流を Fig.7, Fig.8 に示す。水熱処理後の TiO2 膜 においても光電流の発生が認められたが, 熱処

理を施すことにより、それはさらに明瞭になった (Fig.7)。一方、 ZrO_2 膜においても光電流の発 生を検出できた。 ZrO_2 膜では熱処理を施しても、 その大きさに明瞭な変化は認められなかった (Fig.8)。また、その大きさは、 TiO_2 膜におけるそ れの 1/10~1/100 程度であった。







発生する光電流.

4.2.2 濡れ性

骨伝導能, SBF 中での HAp 形成能はその材料の表面状態を強く反映する。そして, その表面状態を整理するパラメータとしては, 水滴接触角が有望であることが報告されている[3]。

Fig.9 に水熱処理後, 熱処理後, 純水中で紫 外光(λ =254 nm, 2020 μ W/cm²)を3h照射後 (UV), 遮光下で純水に3h浸漬後(Dark)の水 滴接触角を示す。滴下した水滴は, 蒸留水, 1 μ L とした。純 Ti 表面に化学処理と水熱処理で TiO₂ 膜を合成すると水滴接触角は著しく減少し た。それに対して, 純 Zr では, 陽極酸化処理と 水熱処理によって ZrO₂ 膜を合成してもほとんど 変化しなかった。ただし, 接触角のばらつきは大 きくなった。これには表面形態の不均一性等, 複数の因子が影響していると考えている。水熱 処理, 熱処理 Ihの ZrO₂では TiO₂と同様, 紫外 光を照射すると接触角は若干小さくなった。表 面の水酸基密度がわずかに上昇したものと思わ れる。一方,熱処理5 hのZrO2では,紫外光照 射の効果は認められなかった。表面の水酸基密 度がかなり低下した結果と思われる。興味深いこ とに,この傾向はTiO2のそれと同じであった。



Fig.9 TiO₂膜, ZrO₂膜の水滴接触角に及ぼす 合成条件,紫外光照射の影響.

4.3 擬似体液(SBF)浸漬試験

各種処理を施した TiO₂ 膜, ZrO₂ 膜を 37 ℃に 保持した Kokubo 溶液に暗所で 2~10 days 浸漬 する SBF 浸漬試験を行った。さらに、初めの 10 h だけ、SBF 中で紫外光照射を行い、その後は 暗所下で SBF 浸漬を続けるパターン(Pre.UV)と SBF 浸漬中、連続的に紫外光照射を行うパター ン(Cont.UV)も行った(Fig.10)。



Fig.10 SBF 浸漬試験における 紫外光照射パターン.

SBFに4 days 浸漬した ZrO2 膜の表面状態を Fig.11 に示す。いずれも HApの折出は観察され なかった。純 Zrでは、今回行った表面修飾や紫 外光照射によって HAp 形成能は大きく変化しな いことが明らかとなった。ここで結果は示してい ないが、熱処理1hの場合も HAp 形成は認めら れなかった。この条件では、紫外光照射すると 水滴接触角の変化から表面の水酸基密度がわ ずかに上昇していると考えているが、この HAp 形成には反映されなかった。

SBFに4 days 浸漬した TiO₂ 膜の表面状態を Fig.12 に示す。水熱処理後の TiO₂ 膜では, 浸漬 2 days より, HAp の旺盛な析出が観察され, 未 処理の純 Ti 表面に比べて, HAp 形成能は著し く向上した。また, Pre.UV を施すと, さらにその 析出は促進された。一方, Cont.UV では, HAp の析出が逆に抑制された。熱処理を施した TiO2 では,水熱処理後に比べ, HAp の析出量は減 少したが,光照射の効果としては同様の傾向が 認められた。熱処理を5h施した表面(HT5h)で は, Cont.UV でHAp 析出は全く観察されなかっ た。熱処理によって表面の水酸基密度が低下し, さらに光応答性も鋭敏化されているためと考え ている。

TiO₂等のn型半導体を水溶液に浸漬すると, 半導体中には水溶液に向かってアップヒルの電 位勾配が生じる(Fig.13)。光照射により励起され た電子(e)と正孔(h)は、その電位勾配により半 導体内部と水溶液側に分離される。この光照射 によって表面の水酸基密度が上昇すると同時に 光照射中は表面が正に帯電し、SBF中の陽イオ ンとの間に斥力が発生することが予想される。そ の結果、HAp形成は Pre.UV で促進され、 Cont.UV で抑制されると考えている。



500 nm

Fig.11 SBF に 4 days 浸漬した ZrO₂ 膜の 表面状態.



Fig.12 SBF に 4 days 浸漬した TiO₂膜の 表面状態.



一般的に、ZrO₂は生体不活性、TiO₂は生体 活性な物質と認識されている。熱処理や光照射 によって、生体不活性な酸化物を生体活性に、 あるいは生体活性な酸化物を生体不活性にで きれば、非常に便利である。今回、純 Zr 表面に 合成した ZrO₂ 膜の表面状態は、熱処理や光照 射にそれほど敏感ではなかった。一方、純 Ti 表 面に合成した TiO₂膜では、熱処理によって表面 の水酸基密度を低下させることができることを SBF 浸漬試験から間接的ではあるが捉えること ができた。それに対し、Pre.UV で HAp 析出を増 加させることもできた。これは、生体活性の回復 に相当する。また、Cont.UV によって、表面の帯 電状態を制御できる可能性も示された。

このように,湿式で合成された TiO₂ では,光 照射を機能切換えのトリガーとして利用できるこ とを示すことができた。

参考文献

- M. Ueda *et al.*, Mater. Sci. Eng. C, 29, 2009, 994-1000.
- 2. M. Ueda *et al.*, Mater. Trans., 50, 2009, 2104-2107.
- D. Yamamoto *et al.*, J. Biomaterials and Nanobiotechnology, 4, 2013, 229-236.

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[学会発表](計3件)

- M. Ueda, M. Kato, M. Ikeda, Formation of Hydroxyapatite on TiO₂ and ZrO₂ in Simulated Body Fluid under UV Irradiation, The 12th Korea/Japan International Symposium on Resources Recycling and Materials Science, Daejeon, Korea, 2014/4/18.
- (2) <u>M. Ueda</u>, M. Ikeda, K. Kuroda, R. Langford, J. Skepper, R.E. Cameron, S.M. Best, Chemical-Hydrothermal Synthesis of Bioactive/Bioinert Oxide Films on CP Ti, Invited, International Symposium on EcoTopia Science 2013, Nagoya University, Japan, 2013/12/14.
- ③ M. Kato, T. Kinoshita, <u>M. Ueda</u>, M. Ikeda, Photo-Induced Formation of Hydroxyapatite on TiO₂ and ZrO₂ in SBF, International Symposium on EcoTopia Science 2013, Nagoya University, Japan, 2013/12/14.

[その他]

http://www.chemmater.kansai-u.ac.jp/ecmate/

 6.研究組織
 (1)研究代表者 上田 正人(UEDA, Masato)
 関西大学・化学生命工学部・准教授 研究者番号:40362660